

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成24年6月28日(2012.6.28)

【公開番号】特開2011-158357(P2011-158357A)

【公開日】平成23年8月18日(2011.8.18)

【年通号数】公開・登録公報2011-033

【出願番号】特願2010-20451(P2010-20451)

【国際特許分類】

G 0 1 N 30/64 (2006.01)

G 0 1 N 27/68 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 30/64 F

G 0 1 N 27/68 B

【手続補正書】

【提出日】平成24年5月15日(2012.5.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 7】

第 2 の態様では、プラズマガス供給口を通してプラズマガスが第 1 ガス流路中に導入され、希釈ガス供給口を通して希釈ガスが第 2 ガス流路中に導入されると、各ガスはいずれも共通化されたプラズマガス排出口及び希釈ガス排出口に向かって流れ、合流して排出される。この場合にも、前者のガス流は第 1 ガス流路中のプラズマ生成領域を通り、後者のガス流は第 2 ガス流路中の電流検出領域を通る。両方のガス流は基本的には独立しているから、それぞれのガス流量はプラズマガス供給口と希釈ガス供給口にそれぞれ設けられたガス流量調整手段により調整可能である。